

The 21st Korean Conference on Semiconductors
제21회 한국반도체학술대회
February 24–26, 2014 / Hanyang University, Seoul, Korea

B. Patterning 분과

[WD1-B] Patterning

Date	Feb. 26, 2014 (Wed.)
Place	Room D / 제1공학관 402호 (# 402, Engineering Building I)

Session Chair: 김현우 교수(한양대학교), 유원종 교수(성균관대학교)

- WD1-B-1 10:50-11:20 Modeling and Analysis of EUV Mask Defects for Resist Pattern**
저자: Sang-Kon Kim
소속: Department of Applied Physics, Hanyang University
- WD1-B-2 11:20-11:35 EUV 마스크 검사용 Coherent EUV 광원 개발**
저자: 김용수^{1,2}, 안준모¹, 성하민³, 조운조¹, 박민철¹, 김점술³, 김재현¹, 우덕하¹, 이석¹, 이주한², 김용태¹, 전영민¹
소속: ¹한국과학기술연구원 센서시스템연구센터, ²서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학과, ³레이저 스펙트라
- WD1-B-3 11:35-11:50 Fabrication of Nano-Size Cross Array Patterns by Nano Imprint Lithography**
저자: Dohyung Kim, Youngin Gil, and Changhwan Choi
소속: Division of Materials Science & Engineering, Hanyang University